

HRTEM image of Si(113)3x2 surface structure



真空度の高い電子顕微鏡内において、シリコンの表面を清浄化してその断面を観察した結果 を示している。(b)の写真中の白い丸がシリコン原子の位置に対応している。最表面の部分に おいては内部とは異なる原子配列をとっていることがわかる。このような表面に出現する特異 な原子配列を表面再構成構造と呼んでいる。



位相物体における像強度は、投影ポテンシャルと ア(hk)のフーリエ変換の虚数項 (フi (xy) とする) とのコンボ リューションで与えられ、 <mark>/</mark>(xy) を アi (xy) というフィルター関数を介してみることに相当する。



特性X線エネルギー

図. LSIコンタクトホールの分析例

HAADF-STEM像 (High Angle Annular Dark-Field Scanning Transmission Microscopy)



原子間距離程度まで集束 した電子ビームを試料上 で走査し、それぞれの ビーム位置において高角 側に散乱された非弾性散 乱電子を円環状検出器に よって2次元マッピング することにより原子分解 能像を得る手法

Zコントラストイメージ 原子コラム位置が常に輝 点として現れる原子直視 性がほぼ保証





代表的なEELSスペクトルとそれに対応する電子励起過程